1

Beschreibung

Photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrats Technisches Umfeld

- [001] Die Erfindung betrifft eine photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrats, aufgebaut aus einer Schutzschicht und hierauf aufgebrachten photokatalytisch aktiven Partikeln, wobei die Schutzschicht keine photokatalytische Aktivität aufweist.
- [002] Der Effekt der Photokatalyse ist lange bekannt und wird insbesondere zur Oxidation von Substraten unter Sonnenlicht oder künstlichem Licht eingesetzt. Die Oxidation kann z.B. in der chemischen Industrie zur gezielten Oxidation von chemischen Verbindungen dienen. Hauptsächlicher Einsatz erfolgt allerdings in der ungerichteten Oxidation von Stickstoffoxiden, Schmutzpartikeln oder von Substanzen mit unangenehmen Geruch.
- [003] Ein Nebeneffekt der photokatalytischen Aktivität ist die hohe Hydrophilie einer solchen Oberfläche. Dies führt zu einer starken Benetzung der Oberfläche mit Wasser, so dass Schmutzpartikel sehr leicht, z.B. durch Regenwasser, von einer solchen Oberfläche abgewaschen werden können. Haupteinsatzgebiet von selbstreinigenden Oberflächen sind Glasfenster bzw. Fassadenbauteile aus glasähnlichen Materialien, da die meisten photokatalytisch aktiven Materialien eine ausreichende Transparenz aufweisen.
- [004] Photokatalytisch aktive Beschichtungen für den Außenbereich müssen eine ausreichende mechanische und chemische Stabilität aufweisen. Die sollte nicht zu Lasten der Aktivität der Beschichtung erfolgen; diese muss auch bei geringer Sonneneinstrahlung, z.B. im Winter, eine ausreichend hohe Aktivität aufweisen.
- [005] Weiterhin ist zu beachten, dass die photokatalytische Aktivität einer Beschichtung nicht nur gegen die gewünschten Substrate, sondern auch gegen das Trägermaterial der Beschichtung wirkt. Im Fall der genannten photokatalytisch aktiven Glasfenster ist dies unerheblich, da anorganische Materialien wie Glas gegenüber Oxidationsreaktionen inert sind.
- [006] Zur Herstellung von photokatalytisch aktiven Beschichtungen offenbart EP 0 630 679 B1 die Calzinierung eines TiO₂-Sols bei höheren Temperaturen. Dies resultiert in einer geschlossenen TiO₂-Schicht mit aufliegenden TiO₂-Partikeln, wobei die so erhaltene photokatalytische Schicht direkt auf dem Träger aufliegt. Eine solche Beschichtung ist für thermolabile und/oder oxidationsempfindliche Trägermaterialien nicht einsetzbar.
- [007] EP 1 074 525 A1 offenbart den Einsatz von N-Typ-Halbleiter materialien als Oberund Unterschicht. Hier findet ein Ladungstransfer vom Trägermaterial durch die Unterschicht zur photokatalytisch aktiven Oberschicht statt, d.h. es sind auch hier Zerset-

zungsprozesse des Trägermaterials zu erwarten.

[008] In EP 0 816 466 A1 ist die Verwendung von TiO₂/SiO₂-Mischungen als photokatalytisch aktive Beschichtung beschrieben. Der SiO₂-Anteil der Mischung soll die photokatalytische Zersetzung des Trägermaterials verhindern, führt jedoch gleichzeitig zu einer Beschichtung der photokatalytisch aktiven TiO₂-Partikel, d.h. zu deren Deaktivierung.

- [009] Analog offenbart EP 1 118 385 A1 die Herstellung eines zweischichtigen Systems mit einer chemisch inerten Unterschicht und einer photokatalytisch aktiven Oberschicht. Die Oberschicht enthält ein Bindermaterial, das wiederum zu einer teilweisen Deaktivierung der photokatalytisch aktiven Partikel führen kann. Weiterhin wird zur Herstellung der Beschichtung ein Calzinierprozess durchgeführt, der bei thermisch labilen Trägermaterialien zu Verformungen oder zu Farbveränderungen des Trägers führen kann.
- [010] Auch EP 1 016 458 A1 beschreibt ein zweistufiges Beschichtungssystem mit einer photokatalytisch aktiven Oberschicht und einer das Substrat schützenden Unterschicht. Die Unterschicht besteht aus einem organisch-anorganischem Hybridpolymer, d.h. aus einer kovalenten Verbindung von Metalloxiden und Polymeren. Die Polymere sind allerdings oxidativ abbaubar und können durch die photokatalytisch aktive Oberschicht angegriffen werden.
- [011] EP 1 066 788 A1 offenbart eine Beschichtung, bei der die photokatalytisch aktive Oberschicht neben dem eigentlichen Photokatalysator (TiO₂) Verbindungen von Metallen der V., VI. und VII. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente als Cokatalysator enthält.
- US 2002/45073 A1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von photokatalytisch aktiven Schichten aus einer kristallinen Phase, bevorzugt TiO₂. Hierzu wird auf ein Substrat zunächst eine Unterschicht aufgebracht, die die Kristallinität der Oberschicht entweder herstellt oder begünstigt. Die kristalline Phase der Oberschicht wird in einem Temperschritt bei erhöhter Temperatur hergestellt. Sowohl Unter- als auch Oberschicht werden in einem physikalischen bzw. nicht-nasschemischen Verfahren durch Sputtern oder CVD-Abscheidung hergestellt. Diese Verfahren sind für große Substratoberflächen zu aufwendig.
- [013] DE 101 58 433 A1 offenbart die Beschichtung von Substraten mit einer Primerschicht, auf die photokatalytisch aktiven Titandioxid-Partikel aufgebracht werden. Die Primerschicht soll als Wasserspeicher dienen und weist daher eine gewisse Porosität auf. Der Einsatz einer porösen Primerschicht kann bei oxidationsempfindlichen Substraten wie Kunststoffen zu unerwünschten, durch die photokatalytischen Partikel ausgelösten, Zersetzungserscheinungen führen.
- [014] Die in DE 101 58 433 A1 offenbarten Beschichtungen benötigen zur Anbindung an

die Substratoberfläche deren physikalisch-chemische Aktivierung z.B. durch Coronastrahlung. Weiterhin ist für thermisch labile Substrate eine schnelle Abbindung der Schichten bei möglichst niedrigen Temperaturen unabdingbar. So führen bei der Beschichtung von Fensterprofilen aus PVC Temperaturen von über 100 °C zu Deformationen, die aber eine passgenaue Weiterverarbeitung des Profils verhindern. Die hier offenbarten Reaktionsbedingungen sind für formgetreue Werkstoffe nur bedingt einsetzbar.

Aufgabe

[015] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, photokatalytisch aktive Beschichtungen bereit zu stellen, die auch für thermisch labile, bzw. oxidationsempfindliche Trägermaterialien geeignet ist.

Darstellung der Erfindung

- [016] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrats aus mindestens zwei nasschemisch hergestellten Schichten mit mindestens einer ersten, auf das Substrat aufgebrachten, aus einem anorganischen Polymer bestehenden Unterschicht und mindestens einer zweiten, aus TiO₂-Partikeln bestehenden Oberschicht, wobei die Unterschicht weniger als 0.5 Gew.% TiO₂-Partikel enthält, porenfrei ist und mindestens 5 Gew.% ZrO₂ aufweist
- [017] Die erfindungsgemäße Unterschicht weist keine Poren auf, deckt das Substrat vollständig ab und sorgt so für den Schutz von oxidationsempfindlichen Oberflächen vor der photokatalytisch induzierten Zersetzung durch die Oberschicht. Dies ist insbesondere bei der Beschichtung von Fensterprofilen aus PVC von Vorteil, da diese ebenfalls Titandioxid enthalten. Würde das in der PVC-Masse enthaltene Titandioxid freigelegt, resultiert eine noch schnellere Zersetzung des Kunststoffs. Die thermische Aushärtung der Unterschicht kann bei so niedrigen Temperaturen erfolgen, dass geformte Halbzeuge wie Profile keine Verformungen erleiden.
- [018] Weiterhin weist die Unterschicht weitgehend keine TiO₂-Partikel auf. Dies bedeutet, dass ausgehend vom Substrat mindestens 85 %, bevorzugt mindestens 90%, ganz bevorzugt mindestens 95% der Schichtdicke der Unterschicht praktisch frei von TiO₂-Partikeln sind, also weniger als 0,5 Gew.% und insbesondere weniger als 0,1 Gew.% TiO₂-Partikel aufweisen.
- [019] Die Unterschicht kann aus mindestes zwei, nacheinander aufgetragenen Schichten gleicher oder unterschiedlicher Zusammensetzung bestehen. Die Maßgaben für den Anteil an TiO₂ und ZrO₂ gelten für die Summe der Teilschichten, können aber auch für jede einzelne Schicht eingestellt werden. So ist es möglich, das eine der Schichten vollständig aus ZrO₂ besteht und eine weitere Schicht aus einem SiO₂/ZrO₂-Gemisch. Die Teilschichen können auch eine gleiche Zusammensetzung, aber unterschiedliche

Dicke, z.B. durch die Auftragung von Suspensionen unterschiedlicher Feststoffgehalte aufweisen.

- Erfindungsgemäße Beschichtungen eignen sich daher insbesondere zur Beschichtung von Substraten aus einem oder mehreren polymeren Materialien und/oder Metallen. Als polymeres Material können ein oder mehrere Polymere, ausgewählt aus der Gruppe Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyacrylate und -metacrylate, wie z.B. Polymethylmetacrylat (PMMA), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC), Polyester, Epoxide, Polyurethane (PU), Polyisocyanate, SBR, ABS, ASA, NBR oder Mischpolymerisate aus Acrylnitril, Styrol, Butadien, Methacrylat oder Isopren, jeweils als Homo- oder Copolymer, als Coextrudat oder als Polymerblend eingesetzt werden.
- [021] Die Substrate können bereits zu Halbzeugen, ggf. mit komplexen geometrischen Formen wie z.B. extrudierte Profile geformt sein. Hier bietet sich der Einsatz von Coextrudaten an. So können z.B. PVC-Halbzeuge wie Fenster- oder Türprofile mit einer Deckschicht aus den genannten Polymeren, insbesondere PMMA, versehen werden.
- [022] Figur 1 zeigt den schematischen Aufbau einer erfindungsgemäßen Beschichtung, wobei S für Substrat, U für chemisch inerte Unterschicht aus dem anorganischen Polymer und P für die photokatalytisch aktive Schicht aus TiO₂-Partikeln steht.
- [023] Die Dicke der ersten Schicht (U in Fig. 1, Unterschicht) beträgt in trockenem, vernetztem Zustand bevorzugt 100 500 nm, besonders bevorzugt 200 500 und insbesondere 300 500 nm.
- [024] Die Dicke der zweiten, photokatalytisch aktiven Schicht (P in Fig. 2, Oberschicht) beträgt in trockenem Zustand bevorzugt 20 100, besonders bevorzugt 20 50 nm.
- Das anorganische Polymer der Unterschicht(en) ist bevorzugt aus einem oder mehreren kovalent miteinander verbundenen Metalloxiden aus der Gruppe SiO₂, ZrO₂, Al₂O₃, Nb₂O₃, Ta₂O₃, CaO aufgebaut. Als anorganisches Polymer wird im Rahmen dieser Erfindung eine z.B. mit dem Sol-Gel-Verfahren der DE 101 58 433 A1 hergestellte Verbindung, die formal aus den genannten Metalloxiden besteht, angesehen. Dies beinhaltet auch die Verknüpfung größerer Einheiten oder Blöcke wie z.B. ZrO₂-Partikel über SiO₂-Brücken.
- [026] Als Unterschicht haben sich anorganische Polymere, die SiO₂ und ZrO₂ im Gewichtsverhältnis 50:50 bis 95:5, insbesondere 75:25 bis 90:10 bzw. 85:15 bis 90:10 enthalten, bewährt. Solche Schichten können optional noch 0,01 bis 2 Gew.% (bezogen auf die Unterschicht) mindestens eines weiteren Metalloxids wie beispielsweise Al₂O₃, Nb₂O₃, Ta₂O₃ oder CaO oder auch Kohlenstoff in Form von Ruß enthalten.
- [027] Die TiO₂-Partikel der photokatalytisch aktiven Oberschicht weisen bevorzugt einen Durchmesser von 5 30 nm, insbesondere 10 bis 25 nm auf; die Verwendung von

Partikeln der Anatas-Modifikation ist gegenüber solchen der Rutil-Struktur zu empfehlen.

- [028] Die photokatalytische Aktivität der TiO₂-Partikel kann durch den Beschichtungsprozess reduziert sein. Zur Reaktivierung der Oberschicht können die Substrate für 1 5 Stunden dem Sonnenlicht oder einer entsprechenden künstlichen UV-Bestrahlung ausgesetzt werden.
- [029] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung photokatalytisch aktiver Beschichtungen auf einem Substrat durch die Verfahrensschritte
 - a. Nasschemisches Beschichten eines Substrats mit einem anorganischen Polymer durch Auftragen einer Suspension des anorganischen Polymeren oder dessen chemische Vorläufer in einem organischen Suspensionsmittel,
 - b. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen Suspensionsmittels unter Erhalt einer Unterschicht.
 - c. Auftragen einer Dispersion aus TiO₂-Partikeln in einem organischen Dispersionsmittel auf die Unterschicht.
 - d. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen Dispersionsmittel unter Erhalt einer Oberschicht.
 - e. Wärmebehandlung der Unter- und Oberschicht bei 20 bis 120°C für 10 bis 300 sec, mit der Maßgabe, dass die Unterschicht weniger als 0.5 % TiO₂-Partikel enthält, porenfrei ist und mindestens 5 Gew.% ZrO₂ enthält.

[030] <u>Verfahrensschritt a</u>

- [031] Die in Verfahrensschritt a) eingesetzte Suspension enthält das anorganische Polymer oder dessen chemische Vorläufer. Als chemische Vorläufer werden Verbindungen verstanden, aus denen die anorganischen Polymere bzw. die genannten Metalloxide hergestellt werden können, insbesondere ein oder mehrere Metalloxide aus der Gruppe SiO₂, ZrO₂, Al₂O₃, Nb₂O₃, Ta₂O₃, CaO, und/oder die entsprechenden Alkoxide, Chloride, Nitrate, Hydroxide, Formiate oder Acetate, jeweils einzeln oder als Gemisch.
- [032] Besonders geeignete Einsatzstoffe für SiO₂ sind Kieselsol, Kieselgel und/oder Kieselsäure, Organosilane wie Alkoxy- oder Alkoxyhydroxysilane, insbesondere Tetraalkoxysilane; für ZrO₂ die Zirkoniumalkoxide wie z.B. Zirkoniumbutanolat oder propanolat. Optional ist die Verwendung von weiteren Metalloxiden, wie z.B. Al₂O₃, ggf. in Form von mit Aluminiumoxid dotiertem SiO₂.
- [033] Die Suspensionen in Verfahrensschritt a) können einen Feststoffgehalt von 0.1 bis 25 Gew.% aufweisen, wobei Feststoffgehalte von 1 bis 5 Gew.% zum Erhalt einer homogenen Schicht bevorzugt sind.
- [034] In einer besonderen Variante der Erfindung wird eine Suspension mit einem Fest-

stoffgehalt von 1 bis 5 Gew.%, bestehend aus SiO₂ (oder einem entsprechendem chemischen Vorläufer) mit den Gew% 50, 75, 85, 90, 95 und ZrO₂ (oder einem entsprechendem chemischen Vorläufer) mit den entsprechenden Gew.% 50, 25, 15, 10 und 5 eingesetzt. Der SiO₂-Anteil besteht wiederum bevorzugt aus einem Kieselsol mit einem Partikeldurchmesser von ca. 5 bis 50 nm und einem Organosilan als Precursor, bevorzugt Tetraalkoxysilan, in einem auf den SiO₂-Feststoff bezogenen Silan-/Kieselsolverhältnis von 50:50 bis 20:80 Gew.%. Der ZrO₂-Anteil wird bevorzugt in Form eines Zirkonium-Alkoxids, hier wiederum bevorzugt des Propanolats oder Butanolats eingesetzt.

- Als organisches Suspensionsmittel eignen sich Alkohole wie Ethanol, Propanol, Isopropanol, Isobutanol, n-Butanol, Wasser, Ameisensäure, und/oder Essigsäure alleine oder als Gemisch, denen ein höher siedendes (zwischen 100 und 200 °C) Benetzungsmittel wie Alkylglykole oder Glycol hier insbesondere Ethylenglycol, Propylenglycol oder Butylenglycol alleine oder als Gemisch zugesetzt wird. Auch Alkohole wie Isopropanol oder n-Butanol sind als Benetzungsmittel geeignet. Zur Vermeidung von Fällungsreaktionen wird der pH-Wert der Suspension mit Ameisensäure oder Essigsäure auf ca. 3,5 eingestellt.
- Das Benetzungsmittel ist insbesondere bei der Beschichtung von polymeren und damit hydrophoben Substraten erforderlich, um deren vollständige und porenfreie Bedeckung mit der Suspension d.h. der Unterschicht bzw. Dispersion der Oberschicht zu ermöglichen. Der Anteil des Benetzungsmittels liegt bevorzugt bei 2 10 Gew.% der Dispersion bzw. Suspension. Das Benetzungsmittel kann zusätzlich ionische oder nicht-ionische Tenside enthalten; bezogen auf die Suspension/Dispersion haben sich Mengen von 0,01 % bis 0,5 Gew.% bewährt.
- Dies Suspension wird mit geeigneten Mitteln auf die Substratoberfläche aufgetragen. Dies kann durch Bestreichen oder Eintauchen erfolgen, als besonders effizient haben sich Sprühverfahren herausgestellt. Die Schichtdicke im nassen Zustand beträgt ca. 10 100 μm. Insbesondere bei Substraten mit komplexen Oberflächenstrukturen, wie z.B. Fensterprofilen haben sich Sprühtechniken, ggf. mit mehreren geometrisch verschieden angeordneten Sprühköpfen bewährt.
- [038] <u>Verfahrensschritt b</u>
- [039] Die in Verfahrensschritt a) aufgetragene Unterschicht wird unter Erhalt einer nassfeuchten Schicht vorgetrocknet. Hierzu wird die Alkoholkomponente der Suspension ganz oder teilweise entfernt. Auf Grund der niedrigen Siedetemperatur kann dies bei 20-40°C erfolgen, bevorzugt bei Raumtemperatur, sodass praktisch keine weitere Wärmebehandlung erforderlich ist. Es ist lediglich für eine geeignete Absaugung der Alkoholdämpfe bzw. deren Wiedergewinnung Sorge zu tragen.
- [040] <u>Verfahrensschritt c</u>

- [041] Die TiO₂-haltige Dispersion besteht bevorzugt aus den bereits genannten organischen Suspensionsmitteln (hier als Dispersionsmittel bezeichnet), Benetzungsmitteln und/oder Tensiden und weist bevorzugt einen Feststoffgehalt von ca. 0,1 bis 2,5 insbesondere 0,1 bis 1 Gew.% TiO₂-Partikel auf. Die TiO₂-Partikel werden bevorzugt in der kristallinen Anatas-Modifikation eingesetzt und weisen insbesondere einen Durchmesser von ca. 5 bis 25 nm auf.
- Auch in diesem Verfahrensschritt haben sich die o.g. Sprüheinrichtungen bewährt. Die Auftragung der photokatalytisch aktiven Schicht auf die noch nassfeuchte Unterschicht hat so zu erfolgen, dass ein Festkleben der TiO-Partikel auf der Unterschicht erfolgt, jedoch praktisch keine Vermischung der Schichten stattfindet. Die Schichtdicke in nassem Zustand beträgt ca. 5 30 μm.
- [043] Verfahrensschritt d
- [044] Dieser Verfahrensschritt entspricht Schritt c) bei der Herstellung der Unterschicht und wird bevorzugt bei Raumtemperatur unter Absaugung der Alkoholkomponente durchgeführt.
- [045] <u>Verfahrensschritt e</u>
- Anschließend erfolgt die Wärmebehandlung und damit Fixierung der Schichten bei Temperaturen von 20 bis 120°C, bevorzugt 20 bis 100°C, besonders bevorzugt 50 bis 80°C. In Sonderfällen kann eine Wärmebehandlung bei 100 bis 120°C angezeigt sein. Die Dauer der Wärmebehandlung hängt von der aufgebrachten Temperatur ab und kann bei niedrigen Temperaturen bis zu 300 sec. betragen. Bevorzugt ist eine Wärmebehandlung von ca. 30 bis 60 sec. Die Wärmebehandlung wird bevorzugt mit IR-Strahlern, Mikrowellengeneratoren oder Lasern durchgeführt, da hier lediglich eine oberflächige Erwärmung des zu beschichteten Substrats erfolgt.
- [047] Die Verfahrensschritte a) bis e) können in einem kontinuierlichen Prozess in Anlehnung an Fig. 2 durchlaufen werden. Die Bezeichnungen a bis e in Fig. 2 entsprechen den Verfahrenschritten a) bis e), wobei in den Schritten a) die Unterschicht U und c) die Oberschicht P aufgetragen wird. Durch geeignete Transportbänder oder ähnliches ist es möglich, die Verfahrensschritte a) und c) bzw. b) und d) in jeweils einer gemeinsamen Einrichtung durchzuführen.
- [048] In einer Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Unterschicht in mehreren Schritten auf des Substrat aufgebracht, d.h. Verfahrensschritte a) und b) werden mindestens zweimal hintereinander durchgeführt.
- [049] Analog kann die Oberschicht in mehreren Schritten auf des Substrat aufgebracht werden, d.h. Verfahrensschritte c) und d) werden mindestens zweimal hintereinander durchgeführt.
- [050] Hierbei hat es sich bewährt, in den einzelnen Arbeitsgängen Suspensionen mit gleicher Zusammensetzung, aber unterschiedlichem Feststoffgehalt einzusetzen. So

kann beispielsweise eine erste Schicht mit einer Suspension eines Feststoffgehalts von 1 Gew. %, und die folgende Schicht mit einer Suspension eines Feststoffgehalts von 5 Gew. % aufgebracht werden. Diese Verfahrensweise ermöglicht gerade bei hydrophoben Substraten wie PVC eine gut adhärierende, homogene, poren -und rissfreie Unterschicht.

[051] Die Figuren 3 bis 16 zeigen REM-Aufnahmen der Oberflächen von PVC-Substraten, frisch aufgetragenen Unterschichten und Unterschichten, die mittels XENO- oder Klimaschrank auf ihre Stabilität getestet wurden.

[052]

Tabelle 1

Figur	Oberfläche	Bewitterung
3	Unbeschichtetes PVC	Keine
4	25nm SiO ₂ -Partikel	Keine
5	25nm SiO ₂ -Partikel	Keine
6	25nm SiO ₂ -Partikel	XENO
7	25nm SiO ₂ -Partikel	XENO
8	25nm SiO ₂ -Partikel	Klimaschrank
9	25nm SiO ₂ -Partikel	Klimaschrank
10	Unbeschichtetes PVC	Keine
11	15nm SiO ₂ -Partikel	Keine
12	15nm SiO ₂ -Partikel	Keine
13	15nm SiO ₂ -Partikel	XENO
14	15nm SiO ₂ -Partikel	XENO
15	15nm SiO ₂ -Partikel	Klimaschrank
16	15nm SiO ₂ -Partikel	Klimaschrank

[053] Die übliche Porenstruktur von PVC (Fig.3) ist durch die Beschichtung geschlossen. Einige natürliche Spannungsrisse ergeben sich durch unterschiedliche Ausdehnungsgrade von Schicht und Substrat. Diese dichte Oberfläche bleibt auch nach künstlicher Bewitterung, wie Frost und Hitze, sowie UV-Belastung erhalten. UV-Strahlung in unnatürlicher Intensität (XENO-Lampe) bewirkt auch thermische Effekte im PVC, was zur Häufung von Spannungsrissen führt. Die Haftung der Schicht auf dem Substrat bleibt jedoch erhalten, wie Fig7 zeigt.

[054] Die Figuren 3 bis 16 zeigen, das die erfindungsgemäßen Unterschichten auch nach der extremen Testbewitterung am Substrat haften und eine Schutzschicht gegenüber

die photokatalytische Oxidation der Oberschicht darstellen.

[055] Weiterhin sind Fensterprofile, Türprofile, Rollladensegmente, Fensterübänke, Architekturverblendungen, Türblätter, Regenrinnen, Regenfallrohre und Kunststoff- oder Aluminiumschalen zur Verblendung von Fenster- oder Türrahmen mit der genannten Beschichtung Gegenstand der Erfindung.

[056] Diese Objekte sind häufig aus PVC, mit oder ohne weiteren Polymeren, Füllstoffen oder Additiven hergestellt. Zweckmäßigerweise werden die Halbzeuge in gewohnter Weise hergestellt, z.B. Fenster- oder Türprofile durch Extrusion. Diese Halbzeuge werden anschließend erfindungsgemäß beschichtet und danach in gewohnter Weise zum fertigen Objekt (Fensterrahmen) montiert.

Bei der Beschichtung von vorgefertigten Halbzeugen aus polymeren Materialien ist während der Trocknungsschritte b) und/oder d) auf eine mögliche Verformung der Objekte zu achten. Optional können die zu beschichteten Substrate vor Verfahrensschritt a) auf eine Temperatur unter dem Vicat-Erweichungspunkt des Substrats vorgewärmt werden. Im Fall von PVC-haltigen Substraten wie Fensterprofilen hat sich eine Vorwärmtemperatur von 35°-65° C bewährt. Bei den Trocknungsschritten b) und/oder d) muss in dieser Verfahrensvariante nur noch eine geringe Temperaturerhöhung erfolgen, sodass eine Verformung des Objekts weitgehend vermieden wird. Alternativ kann nach Abschluss der Verfahrensschritte a) bis e) eine Temperung bei der genannten Temperatur oder eine Kalibrierung des Substrats durchgeführt werden.

Bei der Anwendung im Fenster-/Türbau sei besonders auf die Offenbarung der DE 10 002 658 A1 hingewiesen. Hier wird ein Profilsystem zur Herstellung von Fensteroder Türrahmen aus Kunststoff beschrieben, die mit Aluminium- oder Kunststoffschalen verkleidet sind. Die Aluminiumschalen können mit Kunststoffüberzügen, hier insbesondere Pulverlacke auf Epoxid-, Polyester- oder PVC-Basis in nahezu beliebigen Farben beschichtet werden. Die mit Kunststoffen überzogenen Aluminiumschalen können ebenfalls erfindungsgemäß beschichtet werden.

[059] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher lackierte oder unlackierte, optional mit den genannten Kunststoffen beschichtete Aluminiumschalen zur Verkleidung von Fenster- oder Türrahmen aus Kunststoff mit der oben beschriebenen photokatalytisch aktiven Beschichtung bzw. den beschriebenen Verfahren.

[060] Die so photokatalytisch ausgerüsteten Materialen weisen eine stark hydrophile Oberfläche auf und sind besonders leicht zu reinigen. Sind diese Materialien im Außenbereich eingesetzt und Sonnenbestrahlung sowie Regenwasser ausgesetzt, tritt eine Selbstreinigung ein, da Schmutz durch die photokatalytisch aktive Oberfläche oxidativ angegriffen und von Regenwasser leicht abgespült werden kann.

Beispiele

- [061] Unterschicht, Variante 1
- [062] 20,8 g Tetraethoxysilan, 1,2 g Zirkonbutanolat und 20 g Isopropanol werden unter Rühren mit 10,0 g 0,1 %iger Salzsäure versetzt und eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Die klare Lösung wird anschließend mit 89,4 g Wasser verdünnt. Zum besseren Verlauf werden als Tensid 0,2 g Byk 348 zugesetzt.
- [063] Obererschicht, Variante 1
- [064] 10,0 g Titandioxid Disperal P25 (Degussa) und 0,1 g nichtionisches Tensid Genapol UD 050 werden in 90,0 g 1%iger Ameisensäure vorgelegt. Die Mischung wird 20 min bei 16.000 U/min mit einem Turrax dispergiert. Die weisse Suspension wird hiernach unter schnellem Rühren mit 900,0 g Wasser verdünnt, wobei man eine homogene milchige Lösung erhält.
- [065] Unterschicht, Variante 2
- [066] 20,8 g Tetraethoxysilan, 1,2 g Zirkonbutanolat und 20 g Isopropanol werden unter Rühren mit 10,0 g 0,1%iger Salzsäure versetzt und eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Die klare Lösung wird anschließend mit 89,4 g Isopropanol verdünnt.
- [067] Oberschicht, Variante 2
- [068] 28,4 g (0,10 mol) Titanisopropanolat werden in 170 g Isopropanol gelöst und unter Rühren mit 0,4 g 2M Salzsäure versetzt. Die Lösung wird eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird 1%ige Essigsäure langsam unter schnellem Rühren zu der klaren Lösung gegossen und noch 30 min gelassen. Die Lösung wird danach in einen Autoklaven gefüllt, langsam auf 200°C erhitzt und 8 h bei dieser Temperatur gehalten. Danach wird langsam auf Raumtemperatur abkühlen gelassen.
- [069] Beschichtung
- Eine vorgefertigte Fensterprofilstange aus PVC der Firma profine GmbH wurde zunächst mit Isopropanol gereinigt und getrocknet. Anschließend wurde die Suspension der Unterschicht mit einer Nassfilm-Dicke von ca. 30 µm aufgesprüht und bei Raumtemperatur 30 sec. angetrocknet. Auf die Unterschicht wird die Dispersion der Oberschicht in einer Dicke von ca. 10 µm aufgenebelt. Das Aufsprühen der beiden Schichten erfolgte mit stationären Druckluft-Sprühpistolen, wobei die Profilstange mit einer konstanten Geschwindigkeit unter den Sprühpistolen durchgeführt wurde. Nach kurzem Abtrocknen der Oberschicht bei Raumtemperatur (ca. 30 sec.) erfolgt die thermische Vernetzung der Beschichtung bei ca. 80 °C für ca. 60 sec. mittels eines ca. 1 m langen, parallel zur Profilstange angebrachten IR-Strahlers. Auch hier wurde die Profilstange mit einer konstanten Geschwindigkeit unter dem Strahler durchgeführt, so dass jede Stelle der Oberfläche des Profils im Mittel auf die genannte Temperatur für den genannten Zeitraum erwärmt wurde.
- [071] Es wurde in beiden Fällen eine photokatalytisch aktive und kratzfeste Beschichtung der Profile erhalten.

Ansprüche

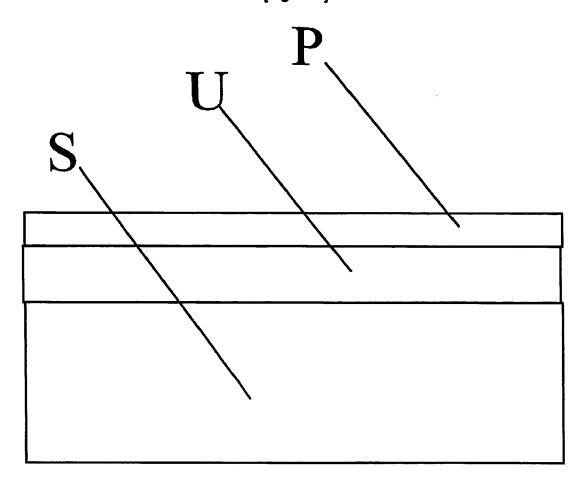
- [001] 1. Photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrats aus mindestens zwei nasschemisch hergestellten Schichten mit mindestens einer ersten, auf das Substrat aufgebrachten, aus einem anorganischen Polymer bestehenden Unterschicht und mindestens einer zweiten, aus TiO Partikeln bestehenden Oberschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterschicht weniger als 0.5 Gew.% TiO₂-Partikel enthält, porenfrei ist und mindestens 5 Gew.% ZrO₂ aufweist. [002]2. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Polymer aus einem oder mehreren kovalent miteinander verbundenen Metalloxiden aus der Gruppe SiO, ZrO, Al, O₃, Nb₂O₃, Ta₂O₃, CaO aufgebaut ist. 3. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-[003] kennzeichnet, dass die Unterschicht aus mindestes zwei, nacheinander aufgetragenen Schichten gleicher oder unterschiedlicher Zusammensetzung besteht. [004] 4. Photokatalytisch aktive Beschichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Substrat ein oder mehrere Polymere ausgewählt aus der Gruppe PVC, PP, PE, PMMA, PS, PC, Polyester, Epoxide, Polyurethane, Polyisocyanate, SBR, ABS, ASA, NBR oder Mischpolymerisate aus Acrylnitril, Styrol, Butadien, Methacrylat oder Isopren, jeweils als Homooder Copolymer, als Coextrudat oder als Polymerblend eingesetzt werden. 5. Verfahren zur Herstellung photokatalytisch aktiver Beschichtungen auf einem [005] Substrat, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte a. Nasschemisches Beschichten eines Substrats mit einem anorganischen Polymer durch Auftragen einer Suspension des anorganischen Polymeren oder dessen chemische Vorläufer in einem organischen Suspensionsmittel, b. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen Suspensionsmittels unter Erhalt einer Unterschicht. c. Auftragen einer Dispersion aus TiO,-Partikeln in einem organischen Dispersionsmittel auf die Unterschicht.

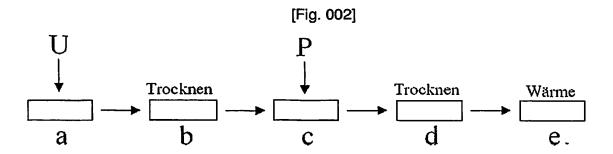
 - d. Ganz oder teilweise Entfernung des organischen Dispersionsmittel unter Erhalt einer Oberschicht.
 - e. Wärmebehandlung der Unter- und Oberschicht bei 20 bis 120 °C für 10 bis 300 sec.
 - mit der Maßgabe, dass die Unterschicht weniger als 0.5 Gew.% TiO -Partikel enthält, porenfrei ist und mindestens 5 Gew.% ZrO enthält.
 - [006] 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die in Verfah-

rensschritt a) eingesetzte Suspension ein oder mehrere Metalloxide aus der Gruppe SiO₂, ZrO₂, Al₂O₃, Nb₂O₃, Ta₂O₃, CaO, und/oder die entsprechenden Alkoxide, Chloride, Nitrate, Hydroxide, Formiate oder Acetate, jeweils einzeln oder als Gemisch enthält.

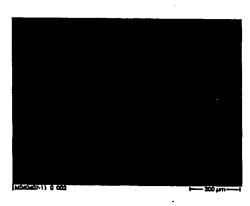
- [007]
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das organische Suspensions- und Dispersionsmittel Ethanol, Propanol, Isopropanol, Isobutanol, n-Butanol, Glycol, Ethylenglycol, Propylenglycol, Butylenglycol, Wasser, Ameisensäure, und/oder Essigsäure alleine oder als Gemisch enthält.
- [800]
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfahrensschritte a) und b) mindestens zweimal hintereinander durchgeführt werden.
- [009]
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verfahrensschritte c) und d) mindestens zweimal hintereinander durchgeführt werden.
- [010]
- 10. Fensterprofile, Türprofile, Rollladensegmente, Fenster Übänke, Architekturverblendungen, Türblätter, Regenrinnen, Regenfallrohre und Kunststoff- oder Aluminiumschalen zur Verblendung von Fenster- oder Türrahmen, mit einer Beschichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4.



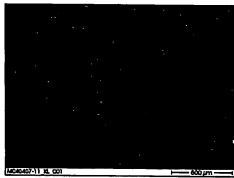




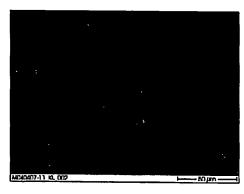
2/5



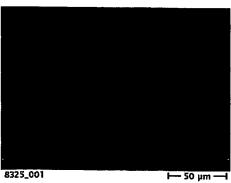
[Fig. 003]



[Fig. 004]

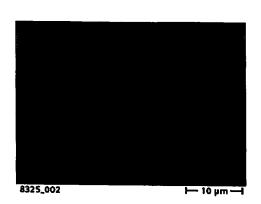


[Fig. 005]

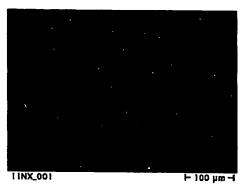


[Fig. 006]

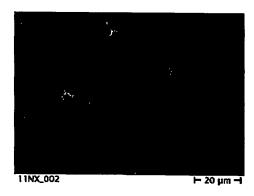
3/5



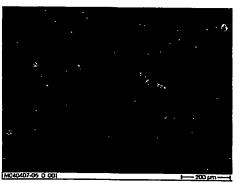
[Fig. 007]



[Fig. 008]



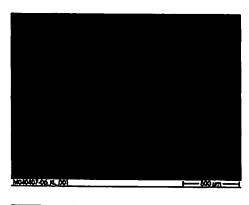
[Fig. 009]



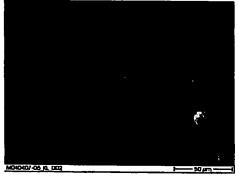
[Fig. 010]

4/5

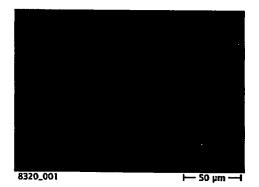




[Fig. 012]



[Fig. 013]



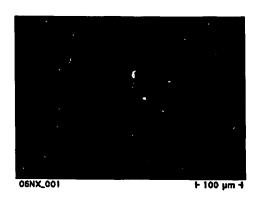
[Fig. 014]



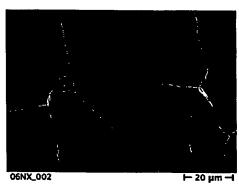
WO 2005/007286 PCT/EP2004/051514

5/5





[Fig. 016]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No T/EP2004/051514

A. CLASSIF IPC 7	REATION OF SUBJECT MATTER B01J21/06 B01J35/00 B01J37/0	25 B01J37/34	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	illon and IPC	
B. FIELDS S	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	on symbols)	
IPC 7	B01J C08J	ni oynavoj	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that so	uch documents are included. In the fields se	arched
Electronic de	ata base consulted during the International search (name of data base	se and, where practical, search terms used)
EPO-Int	ternal, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	avani passages	Relevant to claim No.
x	EP 1 016 458 A (ORIENT CHEMICAL I MUNICIPAL GOVERNMENT (JP)) 5 July 2000 (2000-07-05) cited in the application paragraphs '0009!, '0016!, '0016', '0026! paragraphs '0059! - '0067! claims 12,13		1-10
X	DE 101 58 433 A (NANO X GMBH) 12 June 2003 (2003-06-12) cited in the application examples paragraphs '0014!, '0032! claim 2	-/	1-10
	·		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	In annex.
Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the inte	emational filing date
	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but
	document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	
"L" docume	ucite ent which may throw doubts on priority claim(s) or I is cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or canno involve an inventive step when the di	ocument is taken alone
citatio	in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	ventive step when the
other "P" docum	means ent published prior to the international filing date but	ments, such combination being obvid in the art.	ous to a person skilled
	han the priority date claimed actual completion of the international search	*8" document member of the same palen Date of mailing of the international se	
1			•
 	23 September 2004	07/10/2004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (-31-70) 430-2940 Tv 31 651 end pl	Authorized officer	
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Besselmann. S	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No T/EP2004/051514

	_	TET/EP2004/051514
C.(Continu	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Calegory *		Relevant to claim No.
X	US 2002/045073 A1 (FINLEY JAMES J) 18 April 2002 (2002-04-18) cited in the application paragraphs '0023!, '0026!, '0027!, '0037! examples	1-4,10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
T/EP2004/051514

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 1016458	A	05-07-2000	JP	3550035 B	2 04-08-2004
			JP	2000190415 A	11-07-2000
			JP	2000246114 A	12-09-2000
			EΡ	1437176 A	1 14-07-2004
			ΕP	1016458 A	2 05-07-2000
			US	6228796 B	1 08-05-2001
DE 10158433	Α	12-06-2003	DE	10158433 A	1 12-06-2003
US 2002045073	A1	18-04-2002	AU	3922502 A	27-05-2002
			CA	2417936 A	1 23-05-2002
			ΕP	1315682 A	2 04-06-2003
			JР	2004513864 T	13-05-2004
			WO	0240417 A	2 23-05-2002
			US	2003235720 A	1 25-12-2003
EP 1066878	Α	10-01-2001	EP	1066878 A	1 10-01-2001
			US	6576344 B	1 10-06-2003
			WO	0018504 A	1 06-04-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen
T/EP2004/051514

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B01J21/06 B01J35/00 B01J37/025 B01J37/34 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Rechorchiorter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 B01J C08J Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendele Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X EP 1 016 458 A (ORIENT CHEMICAL IND ; OSAKA 1-10 MUNICIPAL GOVERNMENT (JP)) 5. Juli 2000 (2000-07-05) in der Anmeldung erwähnt Absätze '0009!, '0016!, Absätze '0059! - '0067! '0017!, '0026! Ansprüche 12,13 DE 101 58 433 A (NANO X GMBH) 1-10 X 12. Juni 2003 (2003-06-12) in der Anmeldung erwähnt Beispiele Absätze '0014!, '0032! Anspruch 2 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamille X entnehmen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolfidiert, sondern nur zum Verständnis des der * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dern internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätisdatum veröffentlicht worden ist *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23. September 2004 07/10/2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fac: (+31–70) 340–3016 Besselmann, S

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



internationales Aktenzeichen T/EP2004/051514

A /= : :	(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
C.(Fortsetz Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Dezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle Betr. Anspruch Nr.		
iverañoua.	Davidining and Antoniumonimidi doutes and continuing differ to the mineral continuing	San Ana San Islandi (41)		
X	US 2002/045073 A1 (FINLEY JAMES J) 18. Apr11 2002 (2002-04-18) in der Anmeldung erwähnt Absätze '0023!, '0026!, '0027!, '0037! Beispiele	1-4,10		
A	Absatze 0025:, 0026:, 0027:, 0037: Beispiele EP 1 066 878 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD) 10. Januar 2001 (2001-01-10) in der Anmeldung erwähnt Absätze '0020! - '0024! Beispiel 3			
		·		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Angaban zu Veröffentillengen, die zur selben Patentiamilie gehören

Internationales Aldenzoichen P/EP2004/051514

	cherchenbericht tes Patentdokumen		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentiamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	1016458	A	05-07-2000	JP	3550035 B2	04-08-2004
				JP	2000190415 A	11-07-2000
				JP	2000246114 A	12-09-2000
				EP	1437176 A1	14-07-2004
				EP	1016458 A2	05-07-2000
				US	6228796 B1	08-05-2001
DE	10158433	A	12-06-2003	DE	10158433 A1	12-06-2003
US	2002045073	A1	18-04-2002	AU	3922502 A	27-05-2002
				CA	2417936 A1	23-05-2002
				EP	1315682 A2	04-06-2003
				JP	2004513864 T	13-05-2004
				WO	0240417 A2	23-05-2002
				US	2003235720 A1	25-12-2003
EP 10	1066878	A	10-01-2001	EP	1066878 A1	10-01-2001
				US	6576344 B1	10-06-2003
				WO	0018504 A1	06-04-2000